

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19)世界知的所有権機関
国際事務局



(43)国際公開日
2005年8月4日 (04.08.2005)

PCT

(10)国際公開番号
WO 2005/070691 A1

(51)国際特許分類:
B41C 1/05, G03F 7/00, 7/004, 7/075

B41N 1/12.

(74)代理人: 浅村皓, 外(ASAMURA, Kiyoshi et al.); 〒1000004 東京都千代田区大手町2丁目2番1号 新大手町ビル331 Tokyo (JP).

(21)国際出願番号:

PCT/JP2005/000953

(81)指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(22)国際出願日:

2005年1月26日 (26.01.2005)

(25)国際出願の言語:

日本語

(26)国際公開の言語:

日本語

(30)優先権データ:

特願2004-018470 2004年1月27日 (27.01.2004) JP
特願2004-237600 2004年8月17日 (17.08.2004) JP

(84)指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ヨーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(71)出願人(米国を除く全ての指定国について): 旭化成ケミカルズ株式会社 (ASAHI KASEI CHEMICALS CORPORATION) [JP/JP]; 〒1008440 東京都千代田区有楽町一丁目1番2号 Tokyo (JP).

添付公開書類:

— 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイドスノート」を参照。

(72)発明者: および

(75)発明者/出願人(米国についてのみ): 山田浩 (YAMADA, Hiroshi) [JP/JP]; 〒4110031 静岡県三島市幸原町2-19-13 Shizuoka (JP). 留場啓 (TOMEBA, Kei) [JP/JP]; 〒4160939 静岡県富士市川成島690-1 クリエイトハイツ103 Shizuoka (JP).

(54)Title: PHOTORESISTIVE RESIN COMPOSITION FOR PRINTING SUBSTRATE CAPABLE OF LASER SCULPTURE

A1

(54)発明の名称: レーザー彫刻可能な印刷基材用感光性樹脂組成物

(57)Abstract: A photosensitive resin composition for printing substrate capable of laser sculpture, comprising resin (a) having a polymerizable unsaturated group whose number average molecular weight is in the range of 1000 to 20×10^4 , organic compound (b) having a polymerizable unsaturated group whose number average molecular weight is <1000 and organosilicon compound (c) having at least one Si-O bond in each molecule and having no polymerizable unsaturated group in molecules, wherein the content of organosilicon compound (c) is in the range of 0.1 to 10 wt.% based on the whole of photosensitive resin composition.

WO 2005/070691

(57)要約: 数平均分子量が1000以上20万以下の重合性不飽和基を有する樹脂(a)、数平均分子量が1000未満の重合性不飽和基を有する有機化合物(b)、及び分子内に少なくとも1つのSi-O結合を有し、かつ、分子内に重合性不飽和基を有しない有機ケイ素化合物(c)を含有する、レーザー彫刻可能な印刷基材用感光性樹脂組成物であって、該有機ケイ素化合物(c)の含有率が、該感光性樹脂組成物全体に対し0.1重量%以上10重量%以下である上記感光性樹脂組成物。